# ⑨日本国特許庁

# 公開特許公報

助特許出願公開昭52—151133

⑤Int. Cl². C 07 C 39/08	識別記号	69日本分類 16 C 411	庁内整理番号 6374-43	❸公開 昭和52年(19	77)12月15日
C 07 C 37/00		16 C 411.1	6374-43	発明の数 1	
C 07 C 39/12 #		16 D 1	6532-44	審査請求 未請求	
B 01 J 23/40		16 B 67	6956-43	10 2229777	
B 01 J 23/74		16 C 64	7330-43		(全 4 頁)
C 07 C 102/00		13(9) G 2	6703-4A		(I . A)
C 07 C 103/12					

②特 願 昭51-66417 ②出 願 昭51(1976)6月9日

⑫発 明 者 清浦忠光

鎌倉市梶原1471

⑫発 明 者 小暮靖雄

横浜市戸塚区飯島町2070

加出 願 人 三井東圧化学株式会社

東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号

明細:

1. 発明の名称

ジヒドロキシベンゼン類の製造方法 2.特許請求の範囲

( 式中、 B.J.J. かよび R.は、 同一または異なっ ており、 水素原子、 提素原子数 1 ~ 6 の アルキル基、 またはフェニル基を表わす ) で示される ローオキソーヘキサン酸 アミド類を脱水素触髪 と短形させることを解像とする、

- 校式 R ○ R OH R ○ OH

(式中、Ro、Ro、Ro、Ro、かよびRoは、前配と同一の意味を表わす)で示されるジヒドロキシベンセン類の製造方法

5.祭明の詳細を説明

本発明はジヒドロキシベンゼンまたはジヒド

ロキシベンゼン誘導体の新規な製造法に関する ものである。

これらの化合物は、接着剤、染料、農医薬、 およびホルマリンとの共直合体等の製造原料と して重要な化合物である。

ジヒドロキシベンセン類の製造法は、権々の 方法が公知であり Ger Offen 241237iiには5 - オ キソーへキサン原エステル類を出発物質として、 高離で、自会、パラジウム、ニッケルまたは解 等の金属触媒と接触させ、脱水素课化してジヒ ドロキシベンゼン類を製造する方法が開示され でいる。

しかし、この特許記載の方法では、タールが 興生し生成物を著色するので収率が劣る欠点が ある。

すなわち、ジヒドロキンベンセン類とともに タールの副生を伴うと、これを精製し除去する 必要があり、ジヒドロキンベンゼン類は精製工 使中で変質し易い化合物であるため、副をした タールを含むジヒドロキンベンゼン類の、精製

## 開 FF52--151133(2)

後の収率は、かなり低下する。

本発明者らは、ヒドロキンベンゼン類の製造法代 関し前記の問題のない製造法を提供する目的で、 軽差研究を行った結果、出発物質として5-オキン ヘキサン酸エステルの代わりに、新規を化合物であ 5-オキンヘキサン酸アミドを用いたところ、タ ールの関生を作なわず、収率よくジオキンベンゼン を製造することを見出し本発明を完成するに至水。

すなわち、本発明は、一般式



(式中、 Ri、 Ri、 Ri および Riは、前記と同一の

す) で示されるケトンと、一般式

$$H - C = C - CONH_0$$

( 犬中、 弘かよび B.は、 弘かよび B.と同一の意 族を表わす)で示される不飽和脂肪酸 アミドと を塩落性性 蘇 の 存在下、 液 通 固度 で、 1~6 時間 の E 力、 46~ 300℃ の 範囲 固度 で、 1~6 時間 りにさせて得ることが出来る。 反応に 供するケ トンと不飽和脂肪酸 アミドのモル比 ( ケトン / アミド) は、 5~20の範囲 が好ましい。 塩基性 触族としては、 アルカリ金属 水散 化物、 アルコ ラート、 アルカリ北 紫水酸 化物・ 炭酸塩・水酸 化物、 脂肪 族・ 芳香族 アミン、 塩素性 イォン交 排桐形が有効である。

上記熱媒の使用量は、不飽和脂肪敬アスドの 1 モルに対し、 0.001 ~ 0.1 モルの範囲である。 本発明の製造方法に甘原葉を用いる、触鍵と しては、通常有機化合物の脱水素反応に使用さ れている物が違し、とくに、パラジウム、自金、 ニッケル、偏が好きしい機業成分であり、これ 意味を表わす)で示されるジヒドロキシベンゼン類を回収することからなる、ジヒドロキシベンゼン類の新規な製造方法である。

本発明の製造方法では、反応生成物の収率が 良くタールの副生を作わないため、特製工程の 物略化が出来る。そのため収率の低下もなく、 良好な収率でジヒドロキシベンゼン類が得られる。

以上のように本発明は、出発物質として新規 な化合物を用いる新規な製造法で、かつ工業的 にも有利なジヒドロキシベンゼン類の製造方法 である。

つぎに木発明の、ジヒドロキシベンゼン類の 製造方法について、鮮しく述べる。

本発明で出発物質として用いる5-オキソへ キサン酸アミド類は新規化合物で、一般式

$$R_1 = \begin{pmatrix} H \\ C \\ H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G \\ C \\ H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H \\ C \\ H \end{pmatrix} = R_2$$

(式中、RiおよびRiは、水素原子、炭素原子数 1~6のアルキル基、またはフェニル基を表わ

らの金属の1類もしくは2種以上の混合物を単 飲、または担体に抵持した物を使用する。 触 の担体には、たとえば、炭素、二酸化産素、酸 化丁ルミニウム、酸化マグネシウム、またはこ たち物質の3種以上の混合物が用いられる。と くに、好ましい熱酸系としては、炭素に担持し たパランウムまたは/かよび自金である。

反応は被補もしくは気相、好ましくは気相で 行なわしめる。気相での反応は、触媒と反応温 合物との分離が容易な利点がある。

を発明の製造方法は気相で実施する場合の反復 応条件はつぎのようである。

出現物質である5- メキソへキサン酸アミド 類は、他の不活性が有様化合物、たとえば、ペ ンセン、シクロへキサン等、または無機化合物、 たとえば、弧素もしくは炭酸ガス、とともで加 熱し、希釈されたガス状反応原料として反応に 供する。さらに、この反応原料中に水素ガスを 固合してもよく、水素ガスを添加することによって触載の搭性低下を助止することが出来る。

特開 昭52-151133(3)

水差ガスの混合量は出発物質である 5 - オキソ ヘキサン酸アミド類 1 モルに対して 0.2~10 モル の範囲が適している。

及応額度は、100~500 ℃の範囲、好ましく は、200~400 ℃の範囲が選ばれる、最適の極 度は使用する股水実性媒の種類により異なる。 産液の函膜に加熱した固定床もしくは液動 の勉性に前記のガス状患合反応原料を接触させ る。この時、反応原料の供給量は終ま1 miに対 し5~メキソヘキサ酸アミド類として毎時、GI

~5gの範囲である。反応圧力は常圧ないし10

W/dlの飲用が楽している。

触核状を測過した反応張合物は、冷却すると 緩縮物を与え、この緩縮物から目的物を常法ド により分離する。未反応物は回収して反応系に リサイクルを行えう。一方、本発明の製造法を 権相で実施する場合は、不活性解媒中で行みう。 香供として、トルエン、キンレン、ジフェニル エニテル、ハロゲン化芳香族類、またはパラフ 水素分圧 1 ~ 20 気圧の範囲で、気相で来効す。 のと同様の触葉の存在下に反応させる。用いる 溶鍵に対する 5 ~ オキソーヘキサン酸 アミド型 のモル比(溶群/アミド)は 5 ~ 100 の範囲が 用いられ、用いたアミドに対し1 ~ 10 wtがの触 数を使用する。反応に表する時間は 03 ~ 3 時間 の範囲である。

以下実施例および比較例により本発明を説明する。

# 実施例1

業ガス3モル、鑑素ガス32モルの組成の残合物 を加熱しガス状で、335~340 ℃に加熱した粧 葉を充填した反応管を通過させた。5ーオキソ ヘキサン駅でよげの供給量は散媒の1 xf 当り部 時、0.21 g である。

ィン類が用いられる。反応温度は 50~ 30 º ℃、

2時間反応させ、反応が定常的になってから 生成ガス混合物を2時間、-6℃ に冷却してある トラップに通し、反応生成物を捕集した。

反応生成物を分析した結果、未反応の 5 ー オ キソヘキサン酸 アミド 79 町気 レゾルシン 20 町美、ジヒドロレゾルシン 4.25 町 フェノール 12 町まであった。

#### 実施例2

実施例-1と同様の反応管と反応方法により、 用いる触線と反応物質を変えて反応させた。 無雄は銅20 wt/6、クロム5 wt/6、残りは珠篠

土であって、2 % % × 4 % の鏡剤である。 反応開始前に 450 でで B 10%、 N 90% の混合

ガスを 3 時間流して触媒を活性化した。 4 - メチルー 5 - オキソーヘキサン酸アミド 1 モル、水黒 5 モル、鹽業 3 モルの組成を持つ 反応原料 温合物を 5 時間反応管に流入させた。 4 ーメーカー 5 ー オキソーへキサン限アミド の供給量は毎9、触媒 1 ×4 当たり 0.17 ょである。

反応開始3時間接から、生成物のトラップを 開始し、生成物を2時間補集した。反応生成物 60gが得られた。

反応生成物を分析した結果、未反応 4 - メチルー 5 - オキソヘキサン酸 アミド 5 4 吋 気 4 - メチルー 5 - オキソヘ 2 2 吋所、 4 - メチルー シクロヘキサン - 13 - ジネン 135 吋気 が生成 物中に含有されていた。

#### 実施例3

実施例1と同様の反応器と力法とで 5 - オキソーへキサン酸アミド1モル、水素 8 モル、湿素 8 モルから成る反応混合物を反応させた。反応器には、バラジウム 15 mtが、白金 05 wt 5 全担付した数状の活性炭(20 monh) 3 mtが充填されて同り、触旋床は外部より電気炉で 320 でに加熱されている。

特開 昭52-151133(4)

5-オキソーへキサン酸アミドの供給量は何 時単位拡減当り0.31/mu ChVh1である。反応 開始5時間接に反応生成物の補棄を開始し、5 時間構築を行づた。生成物の補業を開ける3.41で ある。補集物の分析から5-ボキゾーへキサン 銀アミドの転化率35%、レゾルンンへの過剰率83 がであた。相換板は減減負急期でそのまま減 密し、5%15で130~140 CD部出物(レゾル レン)11.71を得た。反応した5-オキソーへ キサン酸アミド芝単で、74.75のレゾルシン収 率である。

## 比較例1

補条被は無褐色で不證明であり、そのまま厳 値するのに適さないため、粉末落性炭により特 製処理してから蒸溜しら % Hoで 130 ~ 140 ℃の 部 し ツ ル ン ン ) 856 gm を得た。反応した 1 gmm ち ー オキソー ヘキサン酸メチルエステル基準で 640 ぎであった。

### 実施例 4

実施例3と同様の数置と方法で、原料のみを 2-メチルー4フェニルー8ーオキソーへキサン原でよりに代へで反応させた。2時間で反応 物が429m補集された。反応後の補集物を分所が した結果、未反応アミド62 \*\*15\*、4-メテルー 6-フェニルーレゾルシン18 \*\*15\*、オルトーフェニルーフェノール21 \*\*15\*、であった。

等許出願人 三井東圧化学株式会社